

成功大學核心設施中心 貴重儀器設備組 機台設備與費用列表

更新日期：2023/04/20

領域	儀器名稱	項目名稱	英文名稱	單位	計畫	非計畫
化學	元素分析儀	NCH	NCH	件	250	1,800
		NCH(空敏、潮解)	NCH(Air sensitive and Deliquescent)	件	300	3,500
		NCHS	NCHS	件	500	3,500
		NCHS(空敏、潮解)	NCHS(Air sensitive and Deliquescent)	件	500	4,500
		O	O	件	250	1,800
		教育訓練	training course	小時	800	1,000
	600MHz 核磁共振儀	13碳及異核圖譜	13C&X nuclear spectrum	件	600	2,500
		二維圖譜	2D spectrum	件	2,000	3,000
		加溶劑	need solvent	件	50	200
		加試管	need tube	件	100	200
		長時間實驗	long time exp.	小時	150	600
		教育訓練-複製	education training	小時	1,100	2,200
		氫譜	1H spectrum	件	250	1,500
	AVIII HD 700MHz高磁場超導核磁共振儀	700NMR 教育訓練	700NMR education training	小時	450	900
		夜間時段或長時間檢測	overnight or long time test	小時	150	1,200
		氫譜	1H	件	250	1,800
		氫譜(含溶劑及試管)	1H(solvent + tube)	件	350	2,000
		異核圖譜及二維圖譜	1D nuclear and 2D spectrum	小時	350	1,800
	固態核磁共振光譜儀	一般光譜及二維光譜	1D&2D spcetrun	小時	150	1,800
		教育訓練	training course	小時	900	1,100
	超導核磁共振儀500NMR	500NMR教育訓練	500NMR education training	小時	450	900
		夜間時段或長時間檢測	overnight	小時	100	600
		氫譜	1H	件	150	600
		氫譜(含溶劑及試管)	1H(solvent + tube)	件	200	600
		異核圖譜及二維圖譜	13C or 2D	小時	200	1,200
	高解析感應耦合電漿質譜分析儀	11-20元素	11-20元素	件	1,000	15,000
		1-3元素	1-3元素	件	200	3,000
		21-30元素	21-30元素	件	1,600	20,000
		31個以上元素	31個以上元素	件	3,000	25,000
		4-6元素	4-6元素	件	350	5,000
		7-10元素	7-10元素	件	500	7,500
		半定量(約65個元素)	半定量(約65個元素)	件	350	2,500
教育訓練		Education training	小時	300	500	

微波加速反應系統	微波消化	Microwave Digestion	台幣	200	800
X光光電子能譜儀-XPS	AES 委託操作-複製	AES scan	件	350	3,500
	GCIB縱深分析-複製	depth profile(GCIB)	小時	650	6,500
	XPS委託操作-複製	survey scan	件	350	3,500
	紫外光光電子能譜-複製	UPS	件	350	3,500
	超時計費-複製	overtime charge	20分鐘	150	1,500
	縱深分析Ar-複製	Depth Profile(Ar)	小時	650	6,500
化學分析電子光譜儀ESCA	表面分析-複製	survey scan Chemical Shift	小時	450	3,500
	教育訓練-複製	training	1小時	850	1,200
	縱深分析-複製	Depth Profile	小時	550	4,000
二次離子質譜儀	教育訓練	Training course	時	350	700
	縱深分布	Depth Profile	件	1,100	6,600
高解析Orbitrap質譜儀串聯液相層析暨晶片電泳分析系統	ESI分子量測定 (Loop, 10次以上進樣)	Molecular weight determination (Loop, above 10 injection)	一次進樣	350	1,400
	ESI分子量測定 (Loop, 1-9次進樣)	Molecular weight determination (Loop, 1-9 injection)	一次進樣	500	2,000
	Mascot資料庫比對(限成大數據, 定性)	Mascot database search (NCKU analyzed data only, Qualitative)	檔案	300	900
	nanoLC-MS/MS分析 (日間自行操作12小時)	nanoLC-MS/MS analysis (Daytime usage:12 hrs)	次	0	0
	nanoLC-MS/MS分析 (夜間/假日自行操作12小時)	nanoLC-MS/MS analysis (Night/Weekend usage:12 hrs)	次	0	0
	nanoLC-MS/MS分析 (蛋白質體分析, 10次以上進樣)	nanoLC-MS/MS analysis (Proteomics, above 10 injection)	一次進樣	1,100	3,300
	nanoLC-MS/MS分析 (蛋白質體分析, 1-9次進樣)	nanoLC-MS/MS analysis (Proteomics, 1-9 injection)	一次進樣	1,500	4,500
	RPLC-MS/MS分析 (10次以上進樣)	RPLC-MS/MS analysis (above 10 injection)	一次進樣	600	2,400
	RPLC-MS/MS分析 (1-9次進樣)	RPLC-MS/MS analysis (1-9 injection)	一次進樣	800	3,200
	RPLC-MS/MS分析 (日間自行操作12小時)	RPLC-MS/MS analysis (Daytime usage: 12 hrs)	次	0	0
RPLC-MS/MS分析 (夜間/假日自行操作12小時)-複製	RPLC-MS/MS analysis (Night/Weekend usage: 12 hrs)	次	0	0	
高解析四極桿飛行時間串聯質譜儀	RPLC-MS/MS 分析(自行操作12小時)	RPLC-MS/MS analysis (12 hrs usage)	次	0	0

高解析氣相層析飛行質譜儀	EI低解析	EI-low-resolution	一個	150	1,500	
	EI高解析	EI-high-resolution	一個	200	2,000	
	FAB低解析	FAB-low-resolution	一個	180	1,800	
	FAB高解析	FAB-high-resolution	一個	270	2,700	
	FD低解析	FD-low resolution	一個	180	1,800	
	FD高解析	FD-high resolution	一個	270	2,700	
	GC/MS	GC/MS	0.5小時 (延長)	50	500	
	GC/MS	GC/MS	半小時 (基本收費)	350	3,000	
	GC/MS 數據處理	GC/MS data processing	0.5小時 (延長)	50	700	
GCMS 教育訓練	GCMS education training	小時	800	1,000		
材料	小角度X光散射儀 (SAXS/WAXS&變溫)	夜間使用費	night charge	小時	150	0
		非計畫 - 夜間使用費	night charge (OEM)	小時	0	300
		非計畫 - 基本使用費	base charge (OEM)	小時	0	600
		基本使用費	base charge	小時	250	0
		開機使用費	base charge	小時	200	400
低掠角薄膜 X 光繞射儀	自行操作	self-operation	時段(兩 小時)	450	450	
	委託操作	OEM	時段(兩 小時)	800	800	
	基本使用費	base charge	hr	50	100	
	無計劃委託操作	OEM(Industry)	時段(兩 小時)	4,000	4,000	
	超時計費	excess time charge	次	150	300	
	資料檢取-TOPAS	TOPAS	次	200	400	
高強度多功能X光薄膜微區繞射儀	Reflectivity	Reflectivity	元/1小時	400	3,000	
	Rocking Curve	Rocking Curve	元/1小時	400	3,000	
	低掠角繞射(2Theta) & 一般繞射(2Theta/Theta)	Glazing angle XRD	元/20分	150	1,000	
	粉末處理費	additional cleaning fee for powder	元/件	50	100	
	高溫分析	H.T. XRD	400/小時 (最少10 小時)	400	3,000	

	教育訓練	training	元/1小時	400	3,000
	殘留應力分析	Residual Stress	元/2小時	800	5,500
	極圖分析	Pole Figure	元/2小時	800	5,500
高溫二維X-ray 廣角繞射儀(粉末X光二維繞射儀)	委託操作	OEM	時段(兩小時)	800	0
	基本使用費	base charge	時段(兩小時)	200	400
	無計劃委託操作	OEM(Industry)	時段(兩小時)	0	4,000
	超時計費	excess time charge	次(現金)	150	300
	資料檢取-TOPAS	TOPAS	次	200	400
單晶X-光繞射儀	定晶面	Index crystal phase	小時	1,000	3,000
	教育訓練	Training	小時	500	500
	晶格常數分析	Index crystal	件	350	1,200
	結構解析	Solve structure	件	600	2,000
	超級使用者	superuser	件	400	0
	超過兩小時數據收集費用(時)	data collected over than 2 hour (hr)	小時	100	300
	數據收集(低溫)	collect data (air cooling)	兩小時	800	5,000
	樣品處理(含空氣敏感)	Select & Mount the Crystal (Including air-sensitive samples)	件	250	1,200
	繞射數據收集	collect data	2小時	600	3,000
白光干涉儀	白光干涉儀教育訓練	White light interferometer measurement training and validation	時	1,500	3,000
	白光干涉儀量測	White light interferometer measurement	時	800	2,000
表面粗度儀	表面粗度儀測量	surface roughness measuring instrument	時	1,000	1,500
	表面粗度儀認證	surface roughness measurment validation	元/次	1,040	1,600
分析型場發掃描式電子顯微鏡	AFE-SEM基本收費	Analytical field emission scanning electron microscope	1小時	400	3,000
	EDS元素分析	EDS analysis	次	100	200
	教育訓練-初階	training	次	1,000	0
	導電金膜(Au)蒸鍍	Electric conduction gold membrane evaporation	次	100	200
多功能環境場發掃描式電子顯微鏡	SEM基本收費	SEM basic charge	1小時	350	3,000
	元素分析	element analysis	次	100	200
	真空鍍金(Au)	vaccum gold-plating	次	100	200
	教育訓練-初階	training	次	1,000	0
	電子背向繞射儀(EBSD)	EBSD analysis	1小時	200	2,500

前瞻聚焦離子束系統	in situ lift out 耗材費	in situ lift out parts fee	片	200	550	
	in-situ lift out	in-situ lift out	小時	250	1,600	
	TEM grid	TEM grid	片	110	200	
	TEM試片製作(委託操作)	TEM sample preparation (Commissioned operation)	片	3,900	13,000	
	加收費用_EDS	Plus fees_EDS	小時	300	1,050	
	教育訓練	Training course	小時	1,320	2,000	
	鍍導電層 Pt	Pt coating	次	120	200	
	離子束顯微鏡	Ion beam Microscopy	小時	2,050	6,300	
	EDS	EDS fee	小時	200	1,000	
	離子束顯微鏡	Ion beam Microscopy	小時	1,320	6,000	
自行操作	TEM教育訓練	TEM training	時	400	600	
	TEM試片前處理	TEM Specimen preparation	片	250	375	
	明場影像、繞射	BF image, Diffraction Pattern	時	700	1,050	
穿透式電子顯微鏡	TEM教育訓練	TEM training	時	400	600	
	TEM試片前處理	TEM Specimen preparation	片	250	375	
高解析穿透式電子顯微鏡	CCD照相使用時間	CCD photo	小時	250	1,400	
	JEOL-2100F Cs STEM自行使用	JEOL-2100F Cs STEM Super User	小時	150	750	
	JEOL-2100F Cs STEM委託操作	JEOL-2100F Cs STEM Request operation	小時	500	1,200	
	化學元素能譜分析	EDS	小時	150	650	
	高效能等離子清潔機	plasma cleaner	小時	100	300	
	高解析成像分析	lattice image	小時	100	450	
	教育訓練	Training Course	小時	1,000	1,500	
	微束繞射分析	nano diffraction	小時	100	450	
	電子能量損失能譜分析	EELS	小時	150	600	
	燈絲使用時間	filament charge	小時	750	2,000	
	CCD照相使用時間	CCD photo	小時	200	700	
	JEOL-2100F Cs STEM自行使用	JEOL-2100F Cs STEM Super User	小時	150	500	
	化學元素能譜分析	EDS	小時	100	300	
	高效能等離子清潔機	plasma cleaner	小時	100	200	
	高解析成像分析	lattice image	小時	100	300	
	微束繞射分析	nano diffraction	小時	100	300	
	電子能量損失能譜分析	EELS	小時	150	400	
	燈絲使用時間	filament charge	小時	750	2,000	
	液態樣品	CCD照相使用時間-複製	CCD photo	小時	250	1,400
		E-chip基本組裝費(不含晶片)-複製	E-Chip Assembly charge	組	700	2,100
加熱功能-複製		heating function	小時	300	900	

	空氣敏感樣品製備	air sensitive sample preparation	次	0	0	
	教育訓練-液態樣品穿透式電子顯微鏡簡介-複製	course-Introduction of liquid cell TEM	小時	300	900	
	液體樣品觀測(流動態)-複製	Liquid Cell TEM (Flow)	小時	1,500	4,500	
	液體樣品觀測(靜態)-複製	Liquid Cell TEM (Static)	小時	1,200	3,600	
	電化學功能-複製	Electrochemical function	小時	300	900	
	燈絲使用時間-複製	filament charge	小時	750	2,000	
	高解析掃描電子顯微鏡	平插式EDS(5060)	EDS(5060)	次	300	600
		研磨拋光機-複製	Grinding and polishing machine	小時	0	0
		教育訓練(初階)	Training	次	800	1,500
		斜插式EDS(5010)	EDS(5010)	次	100	200
		儀器教育訓練(中階)	instrumental education training	次	3,000	5,000
		儀器教育訓練(初階)-複製	instrumental education training	次	1,000	0
		燈絲使用費1小時-複製	HR-SEM basic charge	1小時	450	3,000
		鍍金-複製	Pt coating	次	100	200
		鑲埋機	Mounting Press Machines	顆	500	1,500
	軟物質穿透式電子顯微鏡	CCD使用時間-複製	time of CCD	小時	150	500
		JEOL-JEM1400自行操作(夜間)	JEOL-JEM1400 self (night)	小時	200	800
		JEOL-JEM1400自行操作-複製	JEOL-JEM1400 self	小時	350	1,500
		JEOL-JEM1400委託操作-複製	JEOL-JEM1400 outsource	小時	450	2,500
		教育訓練(低階)	training (low level)	次	1,500	3,000
		教育訓練(高階)	training (high level)	次	8,000	12,000
奈米製程	EVG光罩對準機	機台使用費	Facility fee	一小時	1,800 2,250	
	反應式離子蝕刻機	蝕刻製程使用費(代工/自行操作)	Etch process(Manufacturing Service/Self-operating)	hr	1,800 2,700	
	原子層沉積系統	材料費-Al2O3-複製	Precursor fee-Al2O3	1 cycle	5	6
		材料費-HfO2-複製	Precursor fee-HfO2	1 cycle	10	12
		材料費-SiO2-複製	Precursor fee-SiO2	1 cycle	8	10
		材料費-TiO2-複製	Precursor fee	1 cycle	6	8
	機台使用費-複製	Facility fee	1小時	3,000	4,500	
物理	氮液化系統	液氮桶保溫層抽真空服務	evacuation	桶	1,000 2,000	
		液氮桶降溫處理操作費	precooling	桶	1,000 2,000	
		液態氮操作費	Liquid helium	每公升85元	85	250
	物理性質量測系統儀	比熱量測(變溫及變場)	Heat capacity	小時	450	2,500
		更換樣品	Change sample	件	250	1,200

	稀釋製冷系統	Dilution refrigerator	小時	450	2,500
	電阻量測(變溫、變場及霍爾)	Resistance measurements	小時	450	2,500
	磁化率(交流、直流、變溫及變場)	Susceptibility	小時	450	2,500
	熱電量測(熱傳導、西貝克係數、熱電係數、變溫及變場)-複製	Thermoelectricity	小時	450	2,500
	霍爾量測分析儀-自行操作	Hall effect analyzer (AHM-800B)-self-operation	小時	0	0
	霍爾量測儀-委託操作	Hall effect analyzer (AHM-800B)-measured by operator	小時	800	1,300
	壓力下電阻量測(變溫、變場及霍爾)	Resistance measurements under pressure	次	20,000	20,000
超導量子干涉磁化儀	iQuantumHe3開機費	iQuantum He3 fee	小時	450	2,500
	更換樣品	sample changing	件	100	1,200
	氦三使用費	He3 fee	每件樣品	4,000	5,000
	高溫套件	high temperature	時	250	2,500
	高壓艙使用費	high pressure cell	一件樣品	20,000	20,000
	磁化率	MT curve	時	450	2,500
	尖端服務-磁化率	MT curve	時	400	2,000
	磁滯曲線	MH curve	時	450	2,500
教育訓練	尖端服務-磁滯曲線	MH curve	時	400	2,000
	SQUID教育課程-複製	SQUID Training Course	堂	1,700	3,400

儀器服務項目一覽

國科會 - 預約服務管理系統

